

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成 19 年 5 月 10 日 (2007.5.10)

【公開番号】特開 2004-339605 (P2004-339605A)

【公開日】平成 16 年 12 月 2 日 (2004.12.2)

【年通号数】公開・登録公報 2004-047

【出願番号】特願 2004-94941 (P2004-94941)

【国際特許分類】

C 2 5 D 5/26 (2006.01)

C 2 5 D 5/02 (2006.01)

C 2 5 D 5/34 (2006.01)

C 2 5 D 7/00 (2006.01)

H 0 1 L 23/50 (2006.01)

【F I】

C 2 5 D 5/26 K

C 2 5 D 5/02 B

C 2 5 D 5/34

C 2 5 D 7/00 G

H 0 1 L 23/50 A

H 0 1 L 23/50 D

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 3 月 15 日 (2007.3.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 10

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 10】

- a) 金属合金基体を提供し；
- b) 該金属合金基体をフォトレジストでコーティングし；
- c) 化学線でフォトレジストを選択的に露光してフォトレジスト上にパターンを形成し；
- d) 露光されたフォトレジストを現像して該金属合金基体のパターンを露出させ；
- e) 該露出した金属合金基体をエッチングし；
- f) 該金属合金基体から、残存するフォトレジストを剥離してパターン化された金属合金基体を形成し；
- g) 該パターン化された金属基体上にサテン又は艶消し銅コーティングを堆積し；さらに
- h) 該サテン又は艶消し銅コーティング上にスズ又はスズ合金コーティングを堆積して物品を形成すること、を含む物品の形成方法。